(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2026年8月13日(13.08.2026)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2026/168483 A1

(51) 国際特許分類:
C30B 29/24 (2006.01) *C23C 14/34* (2006.01)
C23C 14/08 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2026/003978

(22) 国際出願日： 2026年2月4日(04.02.2026)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2025-017080 2025年2月4日(04.02.2025) JP

(71) 出願人: 株式会社アルバック (**ULVAC, INC.**) [JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００ (JP).

(72) 発明者: 小林 宏樹 (**KOBAYASHI, Hiroki**); 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００ 株式会社アルバック内 (JP). 露木 達朗(**TSUYUKI, Tatsuro**); 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００ 株式会社アルバック内 (JP). 牛山 史三(**USHIYAMA, Fumitada**); 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００ 株式会社アルバック内 (JP).

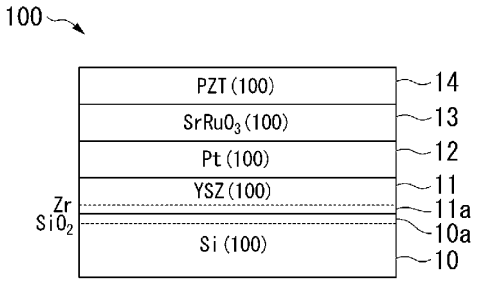
(74) 代理人: 及川 周, 外 (**OIKAWA, Shu** et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) **Title:** METHOD FOR PRODUCING MULTILAYERED STRUCTURE

(54) 発明の名称： 多層構造体の製造方法

[図1]



(57) **Abstract:** A method for producing a multilayered structure according to the present invention comprises: a first epitaxial film formation step for forming, through sputtering on the (100) plane of a silicon substrate, a first layer oriented in the (100) plane; a second epitaxial film formation step for forming, through sputtering on the first layer, a second layer of Pt oriented in the (100) plane; and a third epitaxial film formation step for forming, through sputtering on the second layer, a third layer oriented in the (100) plane.

(57) 要約：本発明の多層構造体の製造方法は、シリコン基板の（１００）面に、（１００）面に配向した第１層をスパッタリングにより形成する第１エピタキシャル成膜工程と、第１層上に、（１００）面に配向したＰｔの第２層をスパッタリングにより形成する第２エピタキシャル成膜工程と、第２層上に、（１００）面に配向した第３層をスパッタリングにより形成する第３エピタキシャル成膜工程と、を有する。

WO 2026/168483 A1

[続葉有]

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MU, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）